

第 35 回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム

2023 年 11 月 11 日

会場: 東北大学 環境科学研究科総合研究棟 大講義室

【基調講演】

- 13:00~13:45 「X 線タイコグラフィによる半導体デバイスのナノ構造イメージング」
東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター
高橋 幸生
- 13:45~14:15 「超純水中の微量金属分析技術の開発」
オルガノ株式会社
東北大学 大学院工学研究科
蔦野 恭平
- 14:15~14:45 「紫外光吸光法によるプロセスチャンバー内の TEMAZ 濃度計測」
株式会社フジキン
東北大学 未来科学技術共同研究センター
稲田 貴郁
- 14:45~15:00 休憩
- 15:00~15:30 「半導体素子の統計的評価に向けたインピーダンス計測プラットフォーム技術」
東北大学 大学院工学研究科
齊藤 宏河
- 15:30~16:00 「画素レベル積層技術を用いた CMOS イメージセンサの小型・低消費電力・高機能化」
ブリルニクスジャパン株式会社
東北大学 大学院工学研究科
宮内 健
- 【特別講演】
- 16:00~16:45 「革新的半導体デバイスを導く最新半導体製造装置」
アプライドマテリアルズジャパン
松永範昭

The 35th International Microelectronics Conference Program

Nov.11, 2023

Venue: Main Building, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University

[Keynote Speech]

13:00~13:45 “Nanostructure imaging of semiconductor devices by X-ray ptychography”

International Center for Synchrotron Radiation Innovation Smart, Tohoku University
Yukio Takahashi

13:45~14:15 “Development of ultra-trace metal analysis technology in deionized water”

ORGANO CORPORATION
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Kyohei Tsutano

14:15~14:45 “Measurement of TEMAZ concentration in process chamber by UV absorption method”

Fujikin Inc.
New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University
Takafumi Inada

14:45~15:00 Break

15:00~15:30 “Impedance Measurement Platform Technology Toward Statistical Evaluation of Semiconductor Devices”

Graduate School of Engineering, Tohoku University
Koga Saito

15:30 ~ 16:00 “Small Size, Low Power, and High Performance CMOS Image Sensors Using Pixel Level Stacking Technology”

Brillnics Japan Inc.
Graduate school of engineering, Tohoku University
Ken Miyauchi

[Special Speech]

16:00~16:45 “New ways in semiconductor manufacturing equipment leading to innovative semiconductor devices”

Applied Materials Japan
Noriaki Matsunaga